Under the ARO TRADER	ANSMITTAL FORM	filing)		10/71 10/12/ Chen-F	rademark formation under the formation under t	
Total Number of F	Pages in This Submission	3		TMIP00	001USA	
Amendmen Afte Affi Extension of Express At Information Certified Co Document(Reply to Mi Incomplete Rep	er Final idavits/declaration(s) of Time Request bandonment Request n Disclosure Statement copy of Priority		Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence A Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) Landscape Table on C0	Address		After Allowance Communication to TC Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):
Firm Name			OF APPLICANT, ATTO	RNEY, C)R AGE	ENT
Signature Printed name	North America Intelle					
D-4-	Winston Hsu 10/14/2004			Reg. No.		
	t this correspondence is bas first class mail in an env	eing facsi		O or depos	sited with	the United States Postal Service with 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Typed or printed name

Date

OCT 1 5 2004 SUPPRESE PRINTERS

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Reperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Complete if Known

FEE TRANSMITTAL for FY 2005

Effective 10/01/2004. Patent fees are subject to annual revision.

____ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$	1	0.	0	0
··	,	•	•	•

Complete if Known			
Application Number	10/711,882		
Filing Date	10/12/2004		
First Named Inventor	Chen-Hsiung Yang		
Examiner Name			
Art Unit		· ·	
Attorney Docket No.	TMIP0001USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)			
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES				
Deposit Account: Order				
Denosit	Fee Fee Fee Fee Description Code (\$)	For Dold		
Account Number 50-3105	1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath	Fee Paid		
Deposit North America Intellectual Presents Com	1052 50 2052 25 Surcharge - late provisional filing			
Account North America Intellectual Property Corp.	cover sheet			
The Director is authorized to: (check all that apply)	1053 130 1053 130 Non-English specification	a avamination		
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812 2,520 1812 2,520 For filing a request for ex parte re			
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804 920* 1804 920* Requesting publication of SIR principles. Examiner action	or to		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805 1,840* 1805 1,840* Requesting publication of SIR at Examiner action	ter		
FEE CALCULATION	1251 110 2251 55 Extension for reply within first m	onth		
1. BASIC FILING FEE	1252 430 2252 215 Extension for reply within secon	d month		
Large Entity Small Entity	1253 980 2253 490 Extension for reply within third n	nonth		
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$) Code (\$)	1254 1,530 2254 765 Extension for reply within fourth	month		
1001 790 2001 395 Utility filing fee	1255 2,080 2255 1,040 Extension for reply within fifth m	onth		
1002 350 2002 175 Design filing fee	1401 340 2401 170 Notice of Appeal			
1003 550 2003 275 Plant filing fee	1402 340 2402 170 Filing a brief in support of an ap	peal		
1004 790 2004 395 Reissue filing fee	1403 300 2403 150 Request for oral hearing			
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451 1,510 1451 1,510 Petition to institute a public use	proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452 110 2452 55 Petition to revive - unavoidable			
	1453 1,330 2453 665 Petition to revive - unintentional			
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE Fee from	1501 1,370 2501 685 Utility issue fee (or reissue)			
Total Claims below Fee Paid Total Claims x = x	1502 490 2502 245 Design issue fee			
Independent	1503 660 2503 330 Plant issue fee			
Claims - 3** = X = X Multiple Dependent	1460 130 1460 130 Petitions to the Commissioner			
	1807 50 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1	.17(q)		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806 180 1806 180 Submission of Information Discle			
Code (\$) Code (\$)	8021 40 Recording each patent assignment property (times number of property)	ent per erties)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 88 2201 44 Independent claims in excess of 3	1809 790 2809 395 Filing a submission after final re (37 CFR 1.129(a))	jection		
1203 300 2203 150 Multiple dependent claim, if not paid	1810 790 2810 395 For each additional invention to	be		
1204 88 2204 44 ** Reissue independent claims over original patent	examined (37 CFR 1.129(b)) 1801 790 2801 395 Request for Continued Examina	ation (RCE)		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802 900 1802 900 Request for expedited examination	` · ·		
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (specify)			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00			
SUBMITTED BY	(Complete (if ap)	olicable))		
	Projetration No.			

SUBMITTED BY		(Complete (if applicable))		
Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. 41,526 (Attorney/Agent)	Telephone	886289237350
Signature	Winters bless		Date	10/14/2004

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



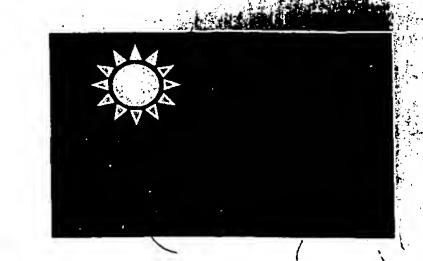
PTO/SB/02B (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

nder the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet

Foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Cop YES	y Attached? NO	
093121813	Taiwan R.O.C.	7/21/2004		V		
	·					

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



BEST AVAILABLE COP

ᄀ

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

/ 其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunde

日: 西元 2004 年 07 月 21

Application Date

093121813 號

Application No.

: 探微科技股份有限公司

Applicant(s)

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT 局 Director General





發文日期: 西元_ 2004年 Issue Date

發文字號: ~ 09320850200

Serial No.

되면 되면 되면 되면 되면 되면 되면 되면 되면 되면





發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字,請勿任意更動,※記號部分請勿填寫)

※申請案號:

※申請日期:

※IPC 分類:

一、發明名稱:(中文/英文)

晶圓載具 /

WAFER CARRIER

二、申請人:(共1人)

姓名或名稱:(中文/英文)

探微科技股份有限公司 /

TOUCH MICRO-SYSTEM TECHNOLOGY INC

代表人:(中文/英文)

李家弘 / LEE, XAVIER C.H.

住居所或營業所地址:(中文/英文)

桃園縣楊梅鎮高山里高獅路五六六號 / No. 566, Gaoshih Rd., Yangmei Township, Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.

國籍:(中文/英文)

中華民國 / TWN

三、發明人:(共1人)

姓 名:(中文/英文)

楊辰雄 / YANG, CHEN-HSIUNG

國 籍:(中文/英文)

中華民國 / TWN

9、
□ 主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實,其
事實發生日期為: 年 月 日。
□ 申請前已向下列國家(地區)申請專利:
【格式請依:受理國家(地區)、申請日、申請案號 順序註記】
有主張專利法第二十七條第一項國際優先權:
無主張專利法第二十七條第一項國際優先權:
□ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權:
【格式請依:申請日、申請案號 順序註記】
主張專利法第三十條生物材料:
□ 須寄存生物材料者:
國內生物材料 【格式請依:寄存機構、日期、號碼 順序註記】
國外生物材料 【格式請依:寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】
□ 不須寄存生物材料者:

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,不須寄存。

五、中文發明摘要:

一種晶圓載具,用以承載一晶圓,其包含有一透明基座 與一導電層。透明基座之尺寸與晶圓之尺寸相近,並利用 一接合層接合晶圓,而導電層之材質則為透明導電材質並 可被一靜電夾盤吸附,藉此靜電夾盤可將晶圓傳輸至各機 台。

六、英文發明摘要:

A wafer carrier for carrying a wafer includes a transparent base and a conducting layer. The transparent base has a size similar to that of the wafer, and bonds the wafer with a bonding layer. The conducting layer is transparent, and can be sucked by an electrostatic chuck so that the electrostatic chuck can deliver the wafer.

七、指定代表圖:

- (一)本案指定代表圖為:第(5)圖。
- (二)本代表圖之元件符號簡單說明:

50	晶圓載具	52	透明基座
54	導電層	58	靜電夾盤
60	接合層	70	晶圓
72	正面	72A	正面圖案
74	背面	74A	背面圖案

八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:

無

九、發明說明:

【發明所屬之技術領域】

本發明係關於一種晶圓載具,尤指一種應用於雙面製程 之晶圓載具。

【先前技術】

超大型積體電路(VLSI)之製作係以由半導體材質構成 之晶圓為基底,配合數十道甚至上百道的半導體製程以於 晶圓上形成具有預設佈局設計之電子元件以及連接線路, 最後再利用切割以及封裝製程將形成之晶粒(die)製作成複 數個晶片(chip)以供使用。而為進行上述半導體製程,如薄 膜沉積、微影、蝕刻與研磨等製程,晶圓必須不斷地於各 機台間傳送,並載入各機台中以進行相關製程。

一般來說,晶圓係利用一真空夾盤加以夾固,並藉此於各機台之間傳輸。請參考第1圖,第1圖為利用一真空夾盤 12 承載晶圓 10 之示意圖。如第1圖所示,晶圓 10 係利用真空夾盤 12 吸附,以載入各機台中以進行相關製程,而真空夾盤 12 包含有複數個連通之孔洞 14,以及一真空幫浦(圖未示),再藉由真空幫浦(圖未示)使孔洞 14 內形成真空狀態,進而吸附位於真空夾盤 12 表面之晶圓 10。

當晶圓 10 所進行之製程係為單面製程時,上述真空夾盤 12 可於固定晶圓 10 時發揮良好的固定效果,然而隨著半導體元件設計日益複雜,許多元件之製作必須進行雙面製程方可完成,例如噴墨頭、晶粒型封裝(CSP)以及各式微機電結構。因此當晶圓 10 之正面圖案形成後需再將晶圓 10 翻轉以進行晶圓 10 之背面製程,此時於運輸晶圓 10 時係利用真空夾盤 12 吸附晶圓 10 之正面。在此情況下晶圓 10 之正面圖案容易造成真空夾盤 12 之吸附效果不佳,甚至導致晶圓 10 之正面圖案受損,特別是於製作微機電元件時,由於微機電元件所使用之晶圓 10 厚度往往小於 300 μm,因此更容易於傳輸過程中受損,而且微機電元件常具有穿孔之結構亦無法利用真空夾盤 12 加以傳輸。

請參考第2圖與第3圖,第2圖與第3圓為利用一靜電 夾盤30承載一晶圓20之示意圖,其中於第2圖中靜電夾 盤30係由晶圓20之背面24來承載晶圓20,而於第3圖 中靜電夾盤30則係由晶圓20之正面22來承載晶圓。如第 2圖所示,傳輸晶圓20時係先利用一接合層26將晶圓20 之背面24與一承載晶圓(carrier wafer)28相接合,接著再 利用靜電夾盤30吸附承載晶圓28之底部,藉此固定承載 晶圓 28 並傳輸晶圓 20,其中承載晶圓 28 係使用與晶圓 28 相同之材質,如裸片(bare wafer),以使靜電夾盤 30 發揮良好的吸附效果,而接合層 26 則係用以接合晶圓 20 與承載晶圓 28。晶圓 20 藉由靜電夾盤 30 之吸附而可於各機台之間進行傳輸,並載入各機台中以進行相關之半導體製程,以於晶圓 20 之正面 22 形成預設之正面圖案 22A。如前所述,由於目前許多半導體元件或微機電元件均需利用雙面製程加以製作,因此於晶圓 20 之正面 22 形成正面圖案 22A後,會再移除接合層 26 並將晶圓 20 翻轉以於晶圓 20 之背面 24 形成背面圖案 24A。

如第 3 圖所示,當晶圓 20 之正面 22 形成了預設之正面 圖案 22A後,晶圓 20 會被翻轉並利用另一接合層 32 將晶圓 20 之正面 22 固定於承載晶圓 28 上,並利用靜電夾盤 30 吸附承載晶圓 28 以將晶圓 20 傳輸至各機台以形成預設之背面圖案 24A。其中值得注意的是進行定義晶圓 20 之背面圖案 24A 的製程時,如微影製程,必須具有準確的對位才能使正面圖案 22A 與背面圖案 24A 具有正確之相對位置,進而製作出高可靠度之元件。一般說來,晶圓 20 之正面 22 會預先形成數個對位記號,藉此於進行背面製程時機台可利用該等對位記號作為基準,以於晶圓 20 之背面 24

的適當位置形成預設之背面圖案 24A。然而習知利用承載 晶圓 28 承載晶圓 20 之作法使得對位記號被遮蔽而無法進 行對位動作,因此極易造成背面圖案 24A 之偏差,如第 3 圖所示,晶圓 20 之背面圖案 24A 即偏離了原先預設之中心 線。

由於習知技術具有上述缺點,因此如何發展出一套可穩固地傳輸晶圓,並且不會造成妨礙機台進行對位之晶圓載具,實為半導體製程上一重要課題。

【發明內容】

因此本發明之主要目的在提供一種晶圓載具,以解決上述習知技術無法解決之難題。

根據本發明之一較佳實施例,係揭露一種晶圓載具,用以承載一晶圓。上述晶圓載具包含有一透明基座與一導電層,其中透明基座之尺寸與晶圓之尺寸相近,並利用一接合層接合晶圓及透明基座,而導電層之材質則為透明導電材質並可被一靜電夾盤吸附,藉此靜電夾盤可將晶圓傳輸至各機台進行製程。

由於本發明之晶圓載具係由透明基座與透明導電層組成,因此不僅可有效藉由靜電夾盤吸附並傳輸至各機台,同時於進行雙面製程時又可容許機台進行對位而能確保晶圓之正面圖案與背面圖案之準確性。除此之外,由於本發明之晶圓載具與晶圓之尺寸相同,因此在不變更機台設計的情況下即可應用機台原有之設備載入與固定。

為了使 貴審查委員能更近一步了解本發明之特徵及技術內容,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖。然而所附圖式僅供參考與輔助說明用,並非用來對本發明加以限制者。

【實施方式】

請參考第4圖與第5圓,第4圖與第5圖為本發明一較 佳實施例之晶圓載具50的示意圖,其中於第4圖中晶圓載 具50係自一晶圓70之背面74承載晶圓70,而於第5圖 中晶圓載具50係自一晶圓70之正面72承載晶圓70。如 第4圖所示,於進行正面製程時,晶圓載具50係自晶圓 70之背面74承載並傳輸晶圓70。晶圓載具50包含有一透 明基座52與一導電層54,其中於本實施例中透明基座52 之尺寸與晶圓70之尺寸相近,且其材質為玻璃、石英或其 他具有相同特性之透明材質,而導電層 54 之材質則為透明導電材質,例如氧化銦錫(ITO)或是氧化銦鋅(IZO)等。透明基座 52 係利用一接合層 56 接合晶圓 70,而導電層 54 則可被一靜電夾盤 58 吸附,藉此靜電夾盤 58 可將晶圓載具50 與晶圓 70 傳輸至各機台。接合層 56 可依接合效果與移除之方便性而選用雙面膠帶、紫外線膠帶、熱分離膠帶、光阻與蠟等。當靜電夾盤 58 將晶圓載具 50 與晶圓 70 傳輸至機台時,機台可依設計不同利用機械夾具、真空夾盤或靜電夾盤等設備將晶圓載具 50 與晶圓 70 同時載入機台內以進行正面製程,以於晶圓 70 之正面 72 形成預設之正面圖案 72A。

當晶圓 70 之正面圖案 72A 製作完成後,晶圓 70 會被翻轉以進行背面製程。如第 5 圖所示,於進行完正面的各種製程後,接合層(圖未示)會被移除使晶圓 70 之背面 74 脫離透明基座 52,接著再利用另一接合層 60 接合透明基座52 與晶圓 70 之正面 72,並利用靜電夾盤 58 吸附導電層54,藉此將晶圓載具 50 與晶圓 70 傳輸至各機台,以進行背面的各種製程。當晶圓載具 50 與晶圓 70 被傳輸至機台時,機台之傳輸設備,如前所述之機械夾具、真空夾盤或靜電夾盤會將晶圓載具 50 與晶片 70 載入,以進行背面製

程。由於進行背面製程時,機台會對晶圓 70 先進行一對位動作,以確保背面圖案 74A 形成之位置之準確性,而本實施例之晶圓載具 50 由於係利用透明基座 52 承載晶圓 70,同時導電層 54 亦係使用透明導電材質,故不會妨礙對位動作的進行,而使形成之背面圖案 74A 具有良好之對位準確性。

由上述可知,由於本發明之晶圓載具50使用透明基座 52 與透明導電材質構成之導電層 54,因此不僅可藉由靜電 夾盤 58 有效吸附導電層 54 藉以傳輸晶圓 70,同時於進行 雙面製程的過程中時,亦可透過該透明導電層以及該透明 基座來對該晶圓表面之該對位記號進行準確對位,以確保 正面圖案 72A 與背面圖案 74A 之相對位置無誤。值得注意 的是上述實施例僅為本發明之一較佳實施例,本發明之晶 圓載具50之導電層54亦可使用非透明導電材質,例如金 屬材質,以使靜電夾盤 58 於傳輸過程中可有效吸附晶圓載 具 50,而值得注意的是在使用非透明導電材質作為導電層 54之情況下,導電層 54必須具備至少一曝露區域以曝露 出晶圓 70 之正面 72 上所標記之對位記號,藉此於進行晶 圓 70 之背面製程時,才能透過該暴露區域以及該透明基座 來對該晶圓表面之該對位記號進行對位動作。此外,對位

記號的位置、數量亦可視製程、機台之需求等而分別設於 晶圓 70 之正面 72 以及背面 74 上,以進行各式定位以及雙 面對準等步驟。

請參考第6圖,第6圖為本發明另一較佳實施例晶圓載 具50之導電層54之示意圖。如第6圖所示,由於於本實 施例中導電層54係為金屬材質,因此導電層54包含有至 少一曝露區域62以曝露出晶圓(圖未示)上預先標記之對位 記號64。如此一來,於進行背面製程時機台可讀取對位記 號64以進行對位。另外值得注意的是,導電層54雖可利 用曝露區域62曝露出對位記號64,但導電層54本身必須 維持相連的狀況,以確保靜電夾盤(圖未示)之靜電吸附效 果。

相較於習知技術,本發明之晶圓載具係由透明基座與透明導電層(或具有曝露區域之金屬層)組成,因此不僅可有效藉由靜電夾盤傳輸至機台,同時於進行雙面製程時又容許機台進行對位而可確保晶圓之正面圖案與背面圖案之準確性。除此之外,由於本發明之晶圓載具與晶圓之尺寸相同,因此在不變更機台設計的情況下即可應用機台原有之設備載入與固定。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。

【圖式簡單說明】

第1圖為一晶圓利用一真空夾盤固定之示意圖。

第2圖與第3圓為利用一靜電夾盤承載一晶圓之示意圖

第4圖與第5圖為本發明一較佳實施例之晶圓載具的示意圖

第6圖為本發明另一較佳實施例晶圓載具之導電層之示意圖

【主要元件符號說明】

10	晶圓	12	真空夾盤
14	孔洞	20	晶圓
22	正面	22A	正面圖案
24	背面	24A	背面圖案
26	接合層	28	承載晶圓
30	靜電夾盤	50	晶圓載具
52	透明基座	54	導電層

56	接合層	58	靜電夾盤
60	接合層	62	曝露區域
64	對位記號	70	晶圓
72	正面	72A	正面圖案
74	背面	74A	背面圖案

十、申請專利範圍:

- 1. 一種晶圓載具(wafer carrier),用以承載一晶圓,其包含有:
 - 一透明基座;以及
 - 一導電層,位於該透明基座之一底表面。
- 如申請專利範圍第1項所述之晶圓載具,其中該透明基 座與該晶圓具有相同之尺寸。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之晶圓載具,其中該透明基 座係為一玻璃晶圓。
- 如申請專利範圍第1項所述之晶圓載具,其中該透明基 座係為一石英晶圓。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之晶圓載具,其中該晶圓載 具另包含有一接合層,設於該透明基座之一上表面,用 來接合該晶圓以及該透明基座以承載該晶圓。
- 如申請專利範圍第5項所述之晶圓載具,其中該接合層之材質係選自於雙面膠帶、紫外線膠帶、熱分離膠帶、

光阻與蠟中之任一者。

- 7. 如申請專利範圍第1項所述之晶圓載具,其中該晶圓載 具係藉由該導電層而得以被一靜電夾盤(electrostatic chuck)吸附,以將該晶圓傳送入至少一機台進行一半導 體製程。
- 8. 如申請專利範圍第7項所述之晶圓載具,其中該半導體 製程係為一雙面製程,且該晶圓包含有至少一對位記 號。
- 9. 如申請專利範圍第8項所述之晶圓載具,其中該導電層係為一透明導電層,藉此該機台可透過該透明導電層以及該透明基座來對該晶圓表面之該對位記號進行一對位動作。
- 10.如申請專利範圍第8項所述之晶圓載具,其中該導電層 係為一不透明導電層,且該不透明導電層具有至少一與 該對位記號之位置相對應之暴露區域,藉此該機台可透 過該暴露區域以及該透明基座來對該晶圓表面之該對 位記號進行一對位動作。

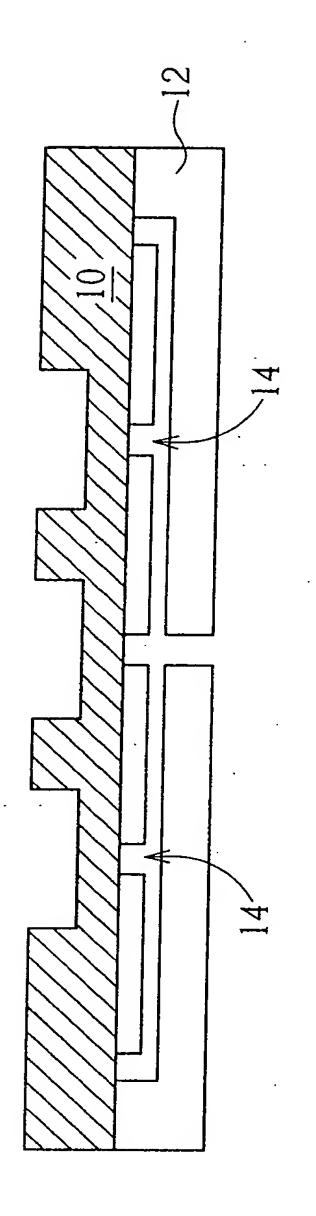
- 11.如申請專利範圍第 10 項所述之晶圓載具,其中該不透明導電層係為互相連接之圖案。
- 12.一種應用於雙面製程之晶圓載具(wafer carrier),用以承載一晶圓,其包含有:
 - 一透明基座;
 - 一導電層,位於該透明基座之一底表面;以及
- 一接合層,位於該透明基座之一上表面,用來接合該晶 圓以及該透明基座。
- 13.如申請專利範圍第 12 項所述之晶圓載具,其中該透明 基座與該晶圓具有相同之尺寸。
- 14.如申請專利範圍第 12 項所述之晶圓載具,其中該透明 基座係為一玻璃晶圓。
- 15.如申請專利範圍第 12 項所述之晶圓載具,其中該透明 基座係為一石英晶圓。
- 16.如申請專利範圍第12項所述之晶圓載具,其中該接合

層之材質係選自於雙面膠帶、紫外線膠帶、熱分離膠帶、光阻與蠟中之任一者。

- 17.如申請專利範圍第 12 項所述之晶圓載具,其中該晶圓載具係藉由該導電層而得以被一靜電夾盤吸附,以將該晶圓傳送入至少一機台進行該雙面製程。
- 18.如申請專利範圍第 17 項所述之晶圓載具,其中該晶圓 包含有至少一對位記號。
- 19.如申請專利範圍第 18 項所述之晶圓載具,其中該導電層係為一透明導電層,藉此該機台可透過該透明導電層以及該透明基座來對該晶圓表面之該對位記號進行一對位動作。
- 20.如申請專利範圍第 18 項所述之晶圓載具,其中該導電層係為一不透明導電層,且該不透明導電層具有至少一與該對位記號之位置相對應之暴露區域,藉此該機台可透過該暴露區域以及該透明基座來對該晶圓表面之該對位記號進行一對位動作。

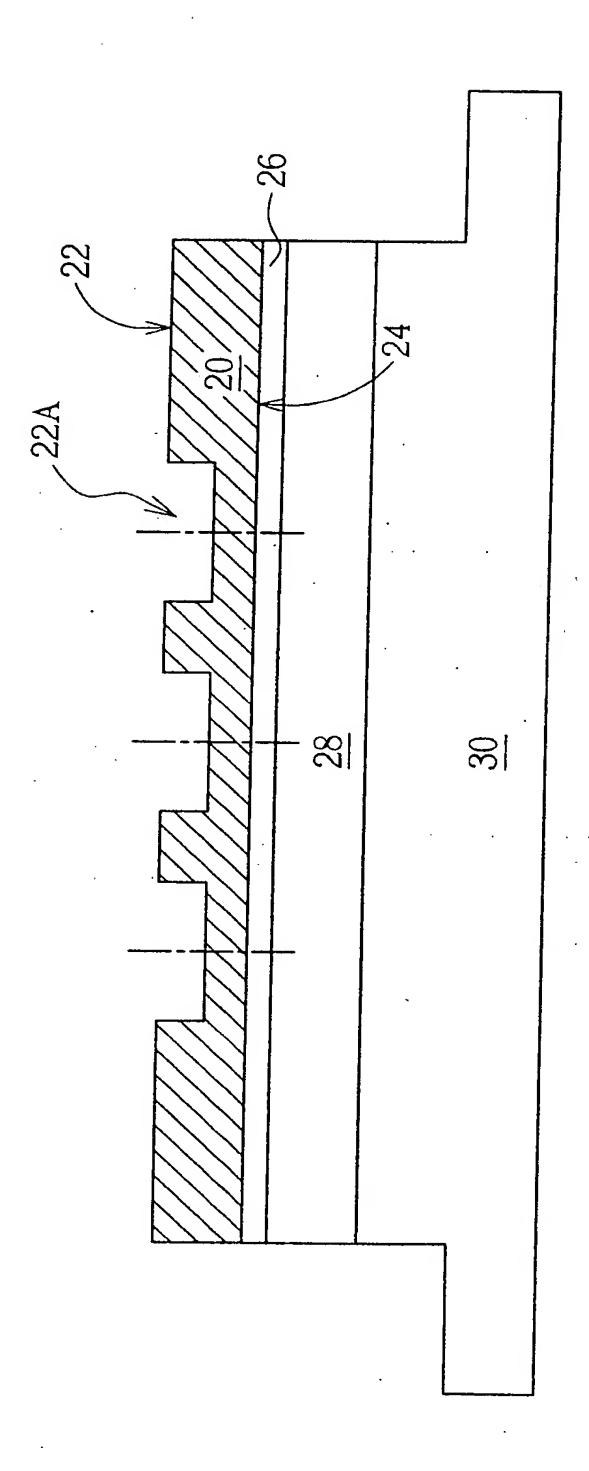
21.如申請專利範圍第 12 項所述之晶圓載具,其中該不透明導電層係為互相連接之圖案。

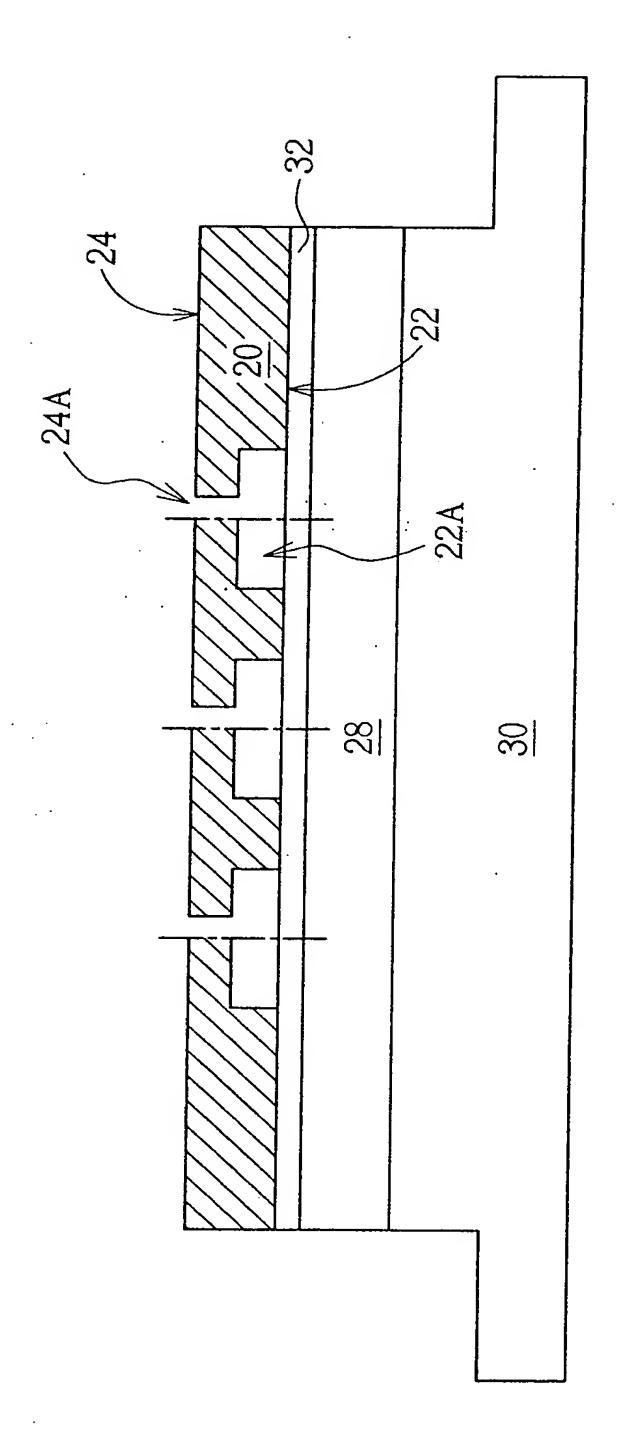
十一、圖式:



第]圖

}





第3圖

